

日本学術振興会 R025 先進薄膜界面機能創成委員会

リトリート学習会 2024 プログラム

日程：2024年7月18日（木）～19日（金）

TKP 東京駅カンファレンスセンター カンファレンスルーム 1A /ハイブリッド開催

第1日目	第2日目
<p>9:30-9:40 開会挨拶 近藤 高志（東京大学）</p> <p>司会 潮 嘉次郎（株ニコン）</p> <p>薄膜工学の基礎</p> <p>9:40-10:25 薄膜の基礎（45分） 近藤 高志（東京大学）</p> <p>10:30-11:15 薄膜の応用（45分） 北川 雅俊（都市活力研究所） Online</p> <p>薄膜評価・作製法（1）</p> <p>11:20-12:05 力学的・機械的性質の評価（45分） 佐々木 信也（東京理科大学） Online</p>	<p>司会 木村 重哉（東芝株）</p> <p>薄膜の機能と応用（1）</p> <p>9:30-10:15 半導体薄膜 ～シリコン～（45分） 浅野 種正（九州大学）</p> <p>10:20-11:05 半導体薄膜 ～化合物～（45分） 藤原 康文（立命館大学）</p> <p>11:10-11:55 磁性薄膜（45分） 斉藤 伸（東北大学）</p>
12:05-12:50 休憩（45分）	11:55-13:00 休憩（65分）
<p>司会 澤野 憲太郎（東京都市大学）</p> <p>～ 新トピックス（1） ～</p> <p>12:50-13:10 金属ハライドペロブスカイト薄膜 近藤 高志（東京大学）（20分）</p> <p>13:15-14:00 結晶構造評価（45分） 酒井 朗（大阪大学）</p> <p>14:05-14:50 薄膜の光学的性質（45分） 潮 嘉次郎（株ニコン）</p> <p>14:50-15:10 休憩（20分）</p> <p>司会 久保田 均（産総研）</p> <p>薄膜評価・作製法（2）</p> <p>15:10-15:55 膜厚・形状評価（45分） 田畑 仁（東京大学）</p> <p>16:00-16:45 物理気相成長（45分） 須田 淳（名古屋大学）</p> <p>16:50-17:35 化学気相成長（45分） 杉山 正和（東京大学）</p> <p>～ 新トピックス（2） ～</p> <p>17:40-18:00 ワイドギャップ半導体（20分） 須田 淳（名古屋大学）</p>	<p>司会 大矢 忍（東京大学）</p> <p>～ 新トピックス（3） ～</p> <p>13:00-13:20 二次元材料 ～グラフェンを中心に～ 橋本 明弘（福井大学）（20分）</p> <p>薄膜評価・作製法（3）</p> <p>13:25-14:10 組成・状態分析（45分） 宮崎 誠一（広島大学）</p> <p>14:15-15:00 薄膜の化学的性質（45分） 徳田 崇（東京工業大学）</p> <p>15:00-15:20 休憩（20分）</p> <p>司会 諏訪 智之（東北大学）</p> <p>薄膜の機能と応用（2）</p> <p>15:20-16:05 有機薄膜（45分） 関谷 毅（大阪大学）</p> <p>16:10-16:55 誘電体薄膜（45分） 大見 俊一郎（東京工業大学）</p> <p>16:55-17:05 閉会挨拶 田畑 仁（東京大学）</p>
18:10-20:10 討論会 ～R025 委員会リトリート学習会のあり方について～	